Reference No. J5145

Dispatch No. 119030

Dispatch Date: April 16, 2002

Decision of Refusal

Patent Application No.

2000-338177

Drafting Date:

April 12, 2002

Examiner of JPO:

7523 Masaki Shibanuma

Title of the Invention: Vacuum Processing Device and

Vacuum Processing Method for

Substrate

Applicant:

Hitachi Ltd.

Agents:

Katsuo Ogawa (and another person)

This patent application is refused for the reason as stated in the notification of reason(s) for refusal dated December 14, 2001.

The argument and amendment have been examined, but no basis sufficient to overthrow the previously given reason(s) for refusal has been found.

#### Remark:

A technical concept that "a substrate is transferred one by one from any location in a cassette to said load lock chamber" is a well-known art (if necessary, refer to the publication of unexamined Japanese Patent application No. Hei 1-170013) and another technical concept that "a substrate is recovered one by one to an original position of the original cassette" is also a mere well-known conventional means as described in the previous cited document 3.

In addition, it is deemed that a technical concept that "the cassette having all the substrates processed therein is recovered from said cassette table and another cassette storing a not-yet processed substrate therein is mounted on said cassette table" to enable itself to be processed continuously is a mere technical matter that persons

skilled in the technical field can naturally expect.

Date of certification: April 15, 2002

Administrative Official of Ministry of Economy, Trade and

Industry Yoshimasa Tsukamoto

I certify that matters described above are identical with the original file.

\_

Japanese Unexamined Patent Publication No. Hei 1-170013 Publication date: June 5, 1989

Patent Application No. S62-328921

Patent Application date: Dec. 25, 1978

Inventor: Shinji Inoue

C/O Teru Kyushu KK

2655, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-Gun,

Kumamoto-Ken,

Applicant: Teru Kyushu KK

2655, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-Gun,

Kumamoto-Ken,

Agent: Patent Attorney; Kazuo Moriya

1. TITLE OF THE INVENTION

Wafer Transfer Method

- 2. WHAT IS CLAIMED IS:
- 1. A wafer transfer method for executing a treatment conforming to the predetermined sequential order in the process for sequentially pre-processing a plurality of wafers accommodated respectively within a plurality of cassettes.
- 2. A wafer transfer method according to claim 1, wherein said cassette includes an identifying part to be recognized and said identifying part is recognized with a recognizing means provided within each treatment.

- 3. A wafer transfer method according to claim 1, wherein said wafer is provided with an identifying part to be recognized and is recognized with a recognizing means provided within each treatment.
- 4. A wafer transfer method according to claim 1, comprising a cassette in which each of two poles is formed of a plurality of linear bar bodies arranged in parallel in the cross-member form and said linear bar bodies of different poles respectively form pairs to place a wafer and two transfer arms provided with a vertical mechanism and a rotary mechanism to have an attracting port at the end part thereof in order to take out the wafer at the predetermined position and accommodate the wafer to the predetermined position with said arm located at the position not contact with said pole during rotation.

## 3. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Industrial Field of Utilization]

The present invention relates to a method of transferring a treatment object.

[Description of the Prior Art and Problem to be Solved by the Invention]

In a semiconductor device maker, wafers are generally manufactured and treated through the treatments such as resist coat, etching, ion implantation, diffusion, oxidation, metal film evaporation and photolithography or the like.

In such a series of manufacturing processes, a plurality of wafers are accommodated within a cassette including an accommodation groove formed in the multiple stages at the internal wall thereof and are then sequentially transferred to each treatment. The cassette accommodating the wafers is

usedinplural numbers and wafers are manufactured through the pre-processing stages as explained above. Therefore, it is essential that the correct treatment sequence is assured and historical record of wafer is obvious. When many cassettes are used, there rises a demerit that if the cassette does not have a recognizing means, the processing sequence of cassettes may be changed and thereby treatment sequence of wafers is also changed. Moreover, within a certain treatment, a cassette is accommodated within the cassette accommodating part, the cassette is moved vertically and the wafers are transferred with a transfer means such as a belt conveyor or the like provided at the lower side of the cassette.

However, this method also has a demerit that the treatment sequence is changed because the wafers are taken out sequentially from the lower side of the cassette and are accommodated from the upper side of the cassette. Moreover, the other method has also been proposed in which the wafers accommodated within the accommodation groove at the internal side of the cassette are taken out with a take-out mechanism. But, this method also has a demerit that since the wafers are accommodated or taken out without confirmation (with a blind operation) under the assumption that the wafer accommodating position and accommodation interval are constant, if a wafer is broken or missed in the sampling inspection, for example, the wafers cannot be accommodated or taken out at the correct position.

Particularly, when the wafers are treated in the small-quantity and multiple-kind treatment corresponding to ASIC, transfer error due to a non-attendant transfer vehicle in the manufacturing line and a transfer error due to the manufacturing apparatus are often generated. Even in

this case, since the treatment is always desirable to be executed for the same kind in the same processing condition, the re-arrangement of the treatments is requested.

It is therefore an object of the present invention to provide a wafer transfer method which can eliminate the demerits explained and is capable of sequentially transferring the wafers in the predetermined sequence in each treatment.

[Means for Solving the Problems]

In order to attain the object explained above, the present invention is characterized in that wafers treated in the predetermined sequence in each treatment to sequentially execute the pre-process of a plurality of wafers accommodated respectively within a plurality of cassettes.

Particularly, the present invention is also characterized in that the cassettes and wafers are provided with an identifying part to be recognized and the identifying part is recognized with a recognizing means provided within each treatment.

Asamethodtorealizetheobjectexplainedabove, the present invention discloses a wafer transfer method comprising a cassette in which each of two poles is formed of a plurality of linear bar bodies arranged in parallel in the spiral form and the linear bar bodies of different poles respectively form pairs to place a wafer and two transfer arms provided with a vertical mechanism and a rotary mechanism to have an attracting portatthe endpart thereof in order to take out the wafer at the predetermined position and accommodate the wafer to the predetermined position with the arm located at the position not contact with the pole during rotation.

#### [PREFERRED EMBODIMENT]

A preferred embodiment of the method of the present invention will be explained with reference to the accompanying drawings.

An identifying part indicating a kind of wafer and a lot number can be formed, as an identifying part of cassette and wafer, by utilizing a method in which a plurality of small holes are perforated and are combined to indicate barcodes and analog values or only the number or symbol is given to such holes. Fig. 1 shows an example in which a barcode (a) is attached to a cassette 1 and a wafer 2. In the wafer 2, such identifying part may be formed along an orientation flat portion.

As a recognizing means for recognizing such identifying part, an optical information processing device or the like is used. A cassette recognizing method using the optical information processing device will be explained with reference to Fig. 2.

In Fig. 2, the cassette 11 accommodating the wafersWhaving completed the processes, for example, the resist coating process and exposure process in the wafer processing devices A and B is provided with an attached tabular member a'on which upper surface the small holes are perforated as the identifying part. The cassette 11 is transferred with the transfer belt b, recognized with the optical information processing device 4 as a recognizing means to recognize the tabular member a' as the recognizing portion and with a reflecting plate 5. The transfer destination of each cassette is determined based on an instruction from a dictionary of the process sequence for each cassette which has been previously edited by the CPU. The cassette is then transferred to the processing device C in order to execute the

next process of the wafers W.

The optical information processing device 4 radiates a laser beam from a laser beam emitting port 6 to irradiate the tabular member a' on the cassette 11 in order to optically detect the boring position with an ITV camera (not illustrated) using the beam reflected from the reflecting plate 5. A detection output signal is compared with the previously stored recognition dictionary and the matched dictionary content is outputted asarecognitioninformation. Moreover, anoutput of the optical information processing device 4 is connected to a memory (not illustrated) in which the cassette processing sequence is stored and thereby this cassette processing sequence can be outputted. In the case where the cassette is transferred to the next development process (not illustrated) after the process with the device C for the next process, for example, with the UV-setting process with these recognition means or transferred in direct to the development process (not illustrated), the cassette which should be transferred is searched. When the cassette of the correct sequence is recognized, this cassette is transferred in direct, but when the cassette of erroneous sequence is recognized, this condition is indicated with a means, for example, a buzzer or the like (not illustrated). As explained above, the cassette can be recognized and processed in the correct cassette processing sequence.

As another embodiment of the cassette recognition method, it is proposed to use a cassette station which is a buffering mechanism. This cassette station will be explained with reference to a perspective view of the cassette station shown in Fig. 3. The cassette disposition locations

21 to 27 are defined on the cassette station 20 and the cassettes 11 on which the identification portion, for example, a barcode (a) is attached are disposed to these locations 22 to 27. The cassettes accommodating the wafers processed in the wafer processing device D are disposed with a robot arm 21 to the cassette disposition locations 22 to 27 on the cassette station 20. The disposed cassettes are transferred to the processing apparatus E of the next process in the correct transfer sequence because the attached barcode a-1 is read with irradiation of a laser beam from the optical information processing device 41 provided at the end point of the robot arm 21.

The barcode a-1 may be read by moving the robot arm 21 for irradiation with the laser beam or by rotating the cassette station 20 through connection of the cassette station to a rotating mechanism. Moreover, it is also possible to read the barcode attached at the position a-2 of the cassette by utilizing an optical information processing device in place of that provided at the endpoint of the robot arm. The optical information processing device 42 is connected to a memory (not illustrated) storing the cassette processing sequence in order to recognize the cassette processing sequence.

In above embodiment, the treatment sequence is designated with the identifying part such as barcode affixed to the cassette but when a treatment as shown in Fig. 2 is executed with only a unit of device such as the devices DandE, the treatment sequence may be designated with the disposition locations 22 to 27 on the cassette station 20.

It is of course possible, in addition to the embodiment of the transfer method including a cassette recognizing means, to transfer the cassette

based on the judgment of a worker by comparing the cassette treatment sequence with the cassette treatment sequence previously stored.

Moreover, as the other embodiment of the transfer method including a wafer recognizing means, an embodiment of a transfer apparatus to realize the transfer method including a means for recognizing the wafer treatment sequencedepending on the accommodation locations of wafers will be explained with reference to the front elevational view of Fig. 4(a), a cross-sectional view of Fig. 4(b) and a side elevation of Fig. 4(c). Namely, an embodiment of taking out the wafers of the same kind when the wafers of different kinds are accommodated within a cassette corresponding to ASIC will then be explained.

In Fig. 4(a), Fig. 4(b) and Fig. 4(c), the cassette 30 is formed of two poles 32 and 32(a) fixed by a bottom plate 31 and an upper plate 31(a) and a linear bar body 33 provided in parallel like a cross-member to the poles 32 and 32(a) and a wafer Wis accommodated on the plane determined by the linear barbody 33. Awafer accommodation arm 34 providing an attracting port (not illustrated) connected to attracting device (not illustrated) at the end point of the backward direction of the pole 32 is coupled with a vertical drive and rotary drive mechanism 34(a) and the wafers transferred with a recipient belt 36 are attracted with the wafer accommodation arm 34. Moreover, a wafer take-out arm 35 providing an attracting port (not illustrated) coupled with an attracting device (not illustrated), like the wafer accommodating arm 34, at the forward direction of the pole 32(a) is connected to the vertical drive and rotary drive mechanism 35(a). The reby, the attracted wafers can be transferred on the transfer belt 37. The wafer

transfer apparatus is connected with a memory to store a accommodating stage 33 of the cassette 30 which is the accommodation position of wafer W. Accordingly, the wafer can be taken out from the desired accommodation position.

The wafer transfermethod in the wafer transfer apparatus structured as explained above will be explained. When a cassette 30 accommodating wafers is accommodated to the cassette accommodating part in a process of the pre-treatment, the wafer take-out arm 35 is lifted with the vertical drive mechanism 35(a). When the arm 35 reaches the target accommodation stage in which the wafer W which should be treated first is accommodated, the take-out arm 35 is rotated with the rotary drive mechanism 35(a) to reach the position of wafer W by drawing an orbit 35(c) to attract the wafer W. Thereafter, the take-out arm 35(c) is rotated again in the inverse direction by drawing the orbit 35(c) and is lowered to the position of the transfer belt 37 with the vertical drive mechanism 35(a). When the take-out arm 35 is placed in contact with the transfer belt 37, the attracting operation is stopped and thereby the wafer W is left on the transfer belt 37 and it is then transferred to the processing device with the transfer belt 37. With repetition of the operation explained above, the wafers may be treated in the correct treatment sequence.

The wafers having completed the treatment in the processing device are transferred with the recipient belt 36 and are then attracted with the accommodating arm 34. This accommodating arm 34 is raised up to an any desired vacant stage with the vertical drive mechanism 34(a). When the accommodating arm 34 reaches the target stage, it is rotated to draw

an orbit 34(c) with the rotary drive mechanism 34(a). When the wafer has come to the accommodation position, the accommodating arm accommodates the arm by suspending the attraction. The arm 34 is in turn rotated to drawtheorbit 34(c) with the rotary drive mechanism 34(a) after accommodation of the wafer and is then moved downward until it is placed in contact with the recipient belt 36. With repetition of the operation explained above, the wafers can be sequentially accommodated in the predetermined sequence.

The method for sequentially taking out or accommodating the wafers from or to the cassette accommodating stage in the correct wafer treatment sequencehasbeen explained above, but the wafers can of course be accommodated and taken out to and from an any accommodating stage even in the case of the sampling test or the like.

In addition to the transfer method utilizing a treatment sequence recognizing means depending on the wafer accommodating position explained above, it is also possible that the wafers are identified and transferred by irradiating, in each processing device, the identifying part on the wafer such as the barcode or combination of the positions of a plurality of small holes perforated with a laser beam using the optical information processing device.

[Effect of the Invention]

According to the present invention, an identifying part to be recognized is provided to a cassette and a wafer, the treatment can be executed in the correct sequence without changing the wafer treatment sequence in the treatment sequentially executed for the wafers. Therefore,

even when the wafer may be broken during the treatment or when the sequence is changed in the sampling inspection, the wafers may be transferred sequentiallywithoutoverlapped accommodationthereoftotheaccommodation stage of cassette or missing of accommodation. Moreover, if a trouble occurs during the manufacturing process, historical record of wafer can be known and therefore the adequate treatment can be conducted.

In addition, when it is requested to change the wafer treatment sequence upon knowing the wafer treatment sequence or when it is requested to accommodate the wafer to the desired location in the cassette, the wafer treatment sequence can be changed freely.

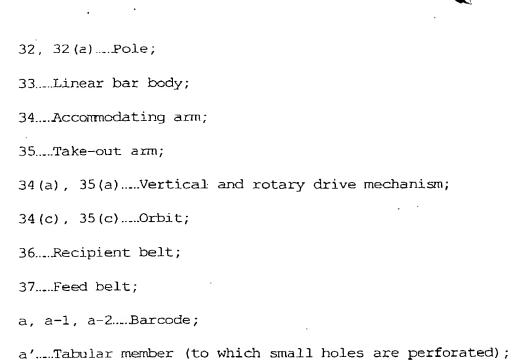
#### 4. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1(a) and Fig. 1(b) are diagrams showing an embodiment of a wafer and a cassette of the present invention.

Fig. 2 and Fig. 3 are diagrams showing an embodiment of the cassette transfer method of the present invention.

Fig. 4(a), Fig. 4(b) and Fig. 4(c) are diagrams respectively showing an embodiment of the wafer transfer method of the present invention.

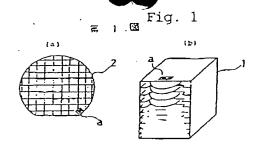
- 1, 11, 30.....Cassette;
- 2....Wafer;
- 4, 41, 42....Optical information processing device;
- 5....Reflecting plate;
- 20.....Cassette station;
- 21....Robot arm;
- 22 to 27....Cassette disposition location;



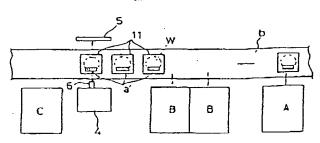
A, B, C, D, E....Processing device;

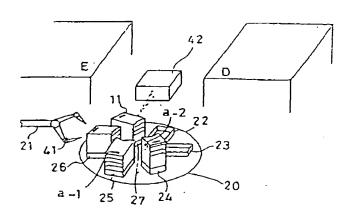
特別平1-170013(5)

需 3 図Fig. 3

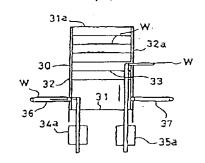


⊊ 2 🖾 Fig. 2



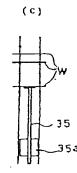


第 4 图 Fig. 4 (a)



34 34c 33 37a
32 33 35c

(b)





#### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## 四公開特許公報(A)

平1-170013

@Int.Cl.*	識別記号	厅内整理番号		❷公開	平成1年(1989)7月5日
H 01 L 21/02 B 65 H 1/28	320	A-7454-5F 7716-3F			The Title and the Control of the Con
1/30	310	· 8310-3F	<b>举</b> 全嗣水	不請求	発明の数 1 (全5頁)

母発明の名称

ウエハ搬送方法

②特 頤 昭62-328921

**塑出** 願 昭62(1987)12月25日

砂発 明 者 井 上 耳 二 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 テル九州株式会社内⑪出 頤 人 テル九州株式会社 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地⑩代 理 人 弁理士 守谷 一雄

867 JAN 27

#### 1. 発明の名称

ウェハ蝦送方法

#### 2、物許請求の範囲

- 1. 複数のカセット内にそれぞれ収納される複数のウェハを順次的処理する工程において、所定の順番によって処理することを特徴とするウェハ 散送方法。
- 2. 前記カセットは認識される級別部を有し、 該意別部を各処項工程内に設けた認識手段により 認識することを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載のウェハ競送方法。
- 3. 前記ウェハは辺間される微別部を有し、多 処理工程内に設けた認識手段によって認識することを特徴とする特許請求の範疇が1 項記録のウェ ハ勘送方法。
- 4. 2本の支柱の各々からさん状に並設された 接数の特状体から成り、足つ相異なる支柱の前記 特状体はそれぞれ対をなしウェハを繋取可能とし たカセットと、垂直機構及び回転機構を確え且つ

先類部に収留口をおする2本の超送アームであって、四駄時に前記支柱に接触しない位置に配置された前記アームにより所望の位置のウェハを取り出し且つ所望の位置にウェハを収納することを特徴とする特許研究の範囲第1項記載のウェハ設送方法。

3. 発明の詳細な説明

【武梁上の利用分野】

本発明は処理体の超送方法に関する。

【従来の技術及び発明が解決しようとする問題点】 半導体製造工程において、一般にウェハはレジストコート、エッチング、イオン往入、拡散、放 化、金属膜藻剤、ホトリングラフィー等の各工程 を経て製造、処理されている。

ごれらの一連の製造工程において、ウェハは内 低に多数に形成された収納は可を有するカセット に複数複収納されて所次各工程に製造されている。 ウェハを収納したカセットは多数使用され、这次 前配のような前処理工程階段を経て製造されるた め、処理期を正しく行い、ウェハの経歴を知る亦



\*ができるようにしておく必要がある。多数のカセットを使用する場合。カセットが認度手段を持たないと、カセットの処理版が狂ってしまい。 使ってウェハの処理版も正しくなされなくなってしまうという欠点があった。 また、一処理工程中においてはカセットをカセット収納部に収納し、カセットを上下移動させて、カセットの下方に装備されたベルトコンベア等の脱送手段で、ウェハの数 ほを行っている。

しかし、この方法ではウェハはカセットの下方から順次取り出され、収納される時はカセットの上方から順次収納されるため処理順番が狂ってしまうという欠点があった。また、他の手段としてカセット内壁の収納得に収納されたウェハを取り出し機構で取り出す方法もあるが、ウェハの収納位限及び収納間隔を一定値としてめくら操作で取り出し、挿入を行っていたので、ウェハの破損や抜きとり決選等で欠番があった場合等、ウェハの透正な位置の取り出し挿入が行われないという欠点があった。

ら成り、且つ相異なる支柱の前記様状体はそれぞれ対を成し、ウェハを裁置可能としたカセットと、 金直機構及び回転機構を構え且つ先端部に吸着口 を有する2本の厳選アームであって、回転時に耐 配支柱に接触しない位置に配置された前記アーム により所強の位置のウェハを取り出し且つ所望の 位置にウェハを取前することを特徴とする。

#### (B)

以下本発明方法の実施例を図面を参照して説明する。

カセット及びウェハの識別部として、パーコードやアナログ散気など複数小孔を穿孔し、これらの位置の組合せあるいは単に番号や記号を付す等の方法を用いることによりウェハの品様、ロット番号などを表示した観別部を形成することができる。第1回にカセット1及びウェハ2にパーコード事を断者した例を示す。ウェハ2においてはオリエンテーションフラット部に沿って形成してもよい。

これらの微別部を認識する記憶手段として光情

特に、ASIC対応で少量多品額になると異適 ラインでの無人脱送率による知送エラーや製造装 盟のトラブルによる搬送エラーなどが多々発生す る。このような場合においても処理は特に同一種 は同一条件処理が望ましいため、処理の再配列が 累まれる。

本発明の目的は上記欠点を解消し、ウェハの各 処理工程において予め定めた処理順に搬送可能な ウェハ搬送方法を提供することにある。

#### [問題点を解決するための手段]

本売明は以上のような目的を達成するため、役 数のカセット内にそれぞれ収納される複数のウェ ハを順次値処理する工器において、各処理工程に おいて所定の断者によって処理することを特徴と する。

特に何記力セット及びウェハは認識される説別 部を有し、譲遠別部を各処理工機内に設けた登録 手段により認識することを特效とする。

このような方法を表現する方法として2本の支 柱の各々からさん状に並設された複数の棒状体か

智処理装設等を用いる。光情報処理装置を用いた カセット認識力益を第2回を用いて説明する。

第2回において、ウェハの処理工程装置である A及びBで処理辨例えばレジスト強布工程、開光 工程済のウェハWが収納されているカセット11 は上面に類別部である小孔を穿孔された板状体。 が貼着され、概述ベルトトによりカセット11は 知透され、識別部である板状体。 を認識する認 選手段である光情報処理突置 4 及び反射板 5 により り認識され、予めCPUで超まれたカセット別工 程順の辞書からの命令に基づき、各カセットにつ き搬送先が快定され、ウェハWの次の処理が行わ れるC数個へ搬送される。

光情報処理装置イはレーザ光射光口6よりレーザ光線を射光し、カセット11上の板状体 a を 原射して反射光を反射振らに反射させ反射光により野孔位置をITVカメラ(図示せず)などにより光度的に数化するものである。数出出力信うと 子の記憶された認識辞費と比較限合し、一致する 辞密内容を認識情報として出力する。さらに光情



報処項装置4の出力はカセットの処理順が記憶された記憶装置(図示せず)に換破され、カセットの処理順を出力することができる。これらの認識手段により、次の処理の行われる装置C例えばUV硬化処理工程で処理後、次の現像工程(図示せず)へ搬送されるかあるいは直接次の規像工程(図示せず)へ撤送する場合、阅送されるべきカセットを探解し、正しい順番のカセットが認識されれば、例えばブザー等の手段(関示せず)で設示させる。このようにしてカセット処理順に正しく認識処理することができる。

カセット認識方法の他の実施例として、バッファリング機構であるカセットステーションを用いる方法がある。第3回に図示のカセットステーションの舒視開を参照してカセットステーションを説明する。カセットステーション20上にカセット戦政位置22~27を設け、ここに類別部である例えばバーコードョが貼着されたカセット11が報置される。ウェハ処理装図Dで処理法のウェ

また、上記の実施例はカセットに貼着したパーコード等の機別部により処理版を認識したが第2 関に示すような一処理工程をそれぞれ製置D. Eのように1台の装置で行う場合は、カセットステーション20の裁U位置22~27により処理期を認知してもよい。

以上のカセットの認識手段を有した数送方法の 実施例の他に予めカセットの契照版を記録してお いたものにカセットの処理所を原合し、人の判所 によって報送してもよい事は言うまでもない。

また、ウェハの収減手段を有する搬送方法の実 随例として、ウェハの収納位回によりウェハの処 理期を認識する手段を有する搬送方法を実現する 撤送装置の一実施的を第4回(a)正面四、第4 回(b)断耐阻、第4回(c)側面回を用いて設 明する。即ち、ASIC対応で1カセット内に複 数品種のウェハが不順に設けられている場合。回 一品種を装埋して取出す場合の表施例を説明する。 第4回(a)、(b) 及び(c)において力セット30は2本の支柱32及び32(b)が底板 ハを収納したカセットステーション20上のカセット級配位置22~27にロボットアーム21により既置される。 吸置されたカセットは次工程の行われる処理装置Eにロボットアーム21の先端に設けられた光情報処理装置41によりレーザ光をパーコードュー1に照射し、その反射光により 読み取りを行い、正しい順番のカセットが散送されるようになっている。

パーコード a - 1 の読み取りは、レーザー光がパーコードの位置に風耐されるようにロボットアーム 2 1 の移動により行ってもよいし、又カセットステーション 2 0 を回転機構に接続し、カセットステーション 2 0 の回転で行ってもよい。又、パーコードの読み取りはロボットアームの失端に設置したものでなく他に設置した光情報処理張双4 2 を使用して、カセットのa - 2 の位置に貼着したパーコードを読み取るようにしてもよい。光情報処理装改4 2 はカセットの処理 p を記憶を記載することができる。

3 1 及び上板 3 1 (a) により固定され、2 水の 支柱32及び32(a)にさん状に並設された移 状体33から形成され、静状体33で決定する1 平面上にウェハWが1枚収納される。支柱32の 後方免以に吸引数値(図示せず)に接続された吸 者口(図示せず)を設けたウェハ収納アーム34 がと下限期及び回転駆動機構3.4 (a) に統約さ れ、受け取りベルト36により閲送されるウェハ をウェハ収納アーム31で吸着できるようになっ ている。又、支柱32.(a)の前方にウェハ収納 アーム34と同様に先然に吸引装置(図示せず) に接続された吸着口(因示せず)を似けたウェハ 取り出しアーム35が上下疑動及び四転駆動機構 35 (a) に接続され、吸着したウェハを送り出 しベルト37上に厳盗することができる。前院の ウェハ酸送裝置は記憶裝倒に接続され、ウェハW の収納場所であるカセット30の収納収33を記 慎することができ、それにより所宜のウェハの収。 幼協所からの取り出し可能になっている。

以上のような構成のウェハ漿送級置におけるウ



ェハの散送方法を説明する。前処理の一工程にお けるカセット納収部にウェハが収納されたカセッ ト30を収めするとウェハ取り出しアーム35が 上下艇動機構35(a)により上昇され、第1に 処理すべきウェハWが収納されている目的の収納 段に運すると、四部駆動機構35(a)により飲 近35 (c)を描いて取り出しアーム35がウェ ハWの位置に選するように回転され、ウェハWを 吸者した後再び軌道35(c)を描いて逆に回転 させ、上下駅動機構35(。)により、送り出し ベルト37の位置まで下降させる。取り出しアー ム35が送り出しベルト37に接触すると吸引を 停止させ、ウェハ♥は送り出しベルト37上に反 置され、送り出しベルト37により処理装置に盥 送される。以上のような動作を傾返すことにより ウェハの処理服を正しく処理を行う事ができる。 **処理製品で処理技のウェハは受け取りベルト36** により撤送され収納アーム34に吸消され、上下 駆動機構34 (a) により収納アーム34を任意 の空段まで上昇させ、目的の段に違すると回転駆

動機網34(a)により軌道34(o)を描くように回転させ、ウェハが収納位置上に収た時、吸引を停止させ収納する。ウェハ収納後回転罷動機構34(a)により軌道34(a)を描くよう逆に回転させ上下駆動機様34(a)により収納アーム34が受け取りベルト38に接するまで下降させる。以上のような動作を反復することによりウェハを扇次所定の順番になるよう収納することができる。

以上ウェハの処理項が狂わないように順次カセット収納段からの取り出し収納について説明したが振き取り検査等任意の収納段へのウェハの収納及び取り出し操作が出来ることは言うまでもない。

以上説明したウェハ収納位置による処理煩認識 季度を用いた競送方法の他に、各処理妨違におい て、バーコードや複数の小孔を穿孔し、その位置 の組合せ等のウェハ上の設別部に光情報処理装置 等を用いてレーザ光を照射し、ウェハの設別を行 いウェハの報送を行ってもよい。

(強明の効果)

本発明によればカセット及びウェハに返譲される預別部を設けたため、ウェハの順次なされる処理工程においてウェハの処理順を狂わせることなく正しい順番で処理することができる。そのため処理装置中でのウェハの破損が起った時、抜き取り設定で順番が欠者した場合等でもカセットの収益的に重複して収納したり抜けがあったりすることなく順次搬送できる。又、製造中不部合があった場合でもウェハの経歴がわかるので好意な処理を行うことができる。

又、ウェハの処理風を知ると同時にウェハの処 環順を変更したい時あるいはカセットの所望の位 置に収納したい時でも自由に変更することができ る。

#### 4. 関面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)は本発明に係るウェハ及びカセットの一実施例を示す図、第2回及び第3回はそれぞれカセット認送方法の一実施例を示す回、第4回(a)..(b)及び(c)はそれぞれ本発明のウェハ吸送方法に用いられる一次原例

#### を示す回である.

1、11、30・・・・・カセット

2・・・・・・ウェハ

4、41、42 ···· 光情報処理裝置

5 · · · · · 反射板

20・・・・カセットステーション

21・・・・・ロボットアーム

22~27・・・・カセット就政位置

32、32 (a) ····· 支柱

33……钻状体

35・・・・・ 取り出しアーム

34(a)、35(a)····上下及び回転照肋機構

36・・・・・受け取りベルト

37・・・・・送り出しベルト

a. a-1. a-2 ·····バーコード

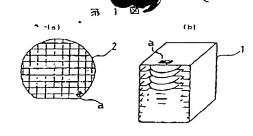
a· ····· 小孔穿孔板

A. B. C. D. E····· 処理装置

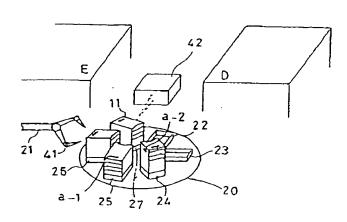
代型人 弁理士 守 谷 一 鐵

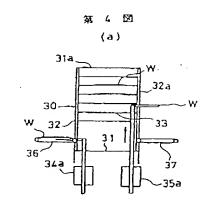


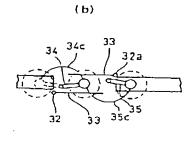
第 3 🖾

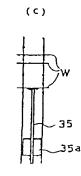


© B B A









# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.